

TECHNICAL SPEC FOR Wet processing system

System Model:

DNS 80B

Specific Model: 700304050A

Wafer size: 6 inch

Process: DI water clean

Chemicals used: DI water CO2

Wafer material: 6 inch Jeida flat

SMIF: no

Indexer Robot: Yes

Transfer Robot: Yes

Front-Side Spin Scrub Units: 2 (Softspray)

Back-Side Spin Scrub Units: 2 (Softspray)

Reverse Unit: Yes

OF/Notch: OF

Pumps: NA

Controllers:

SECS: Yes

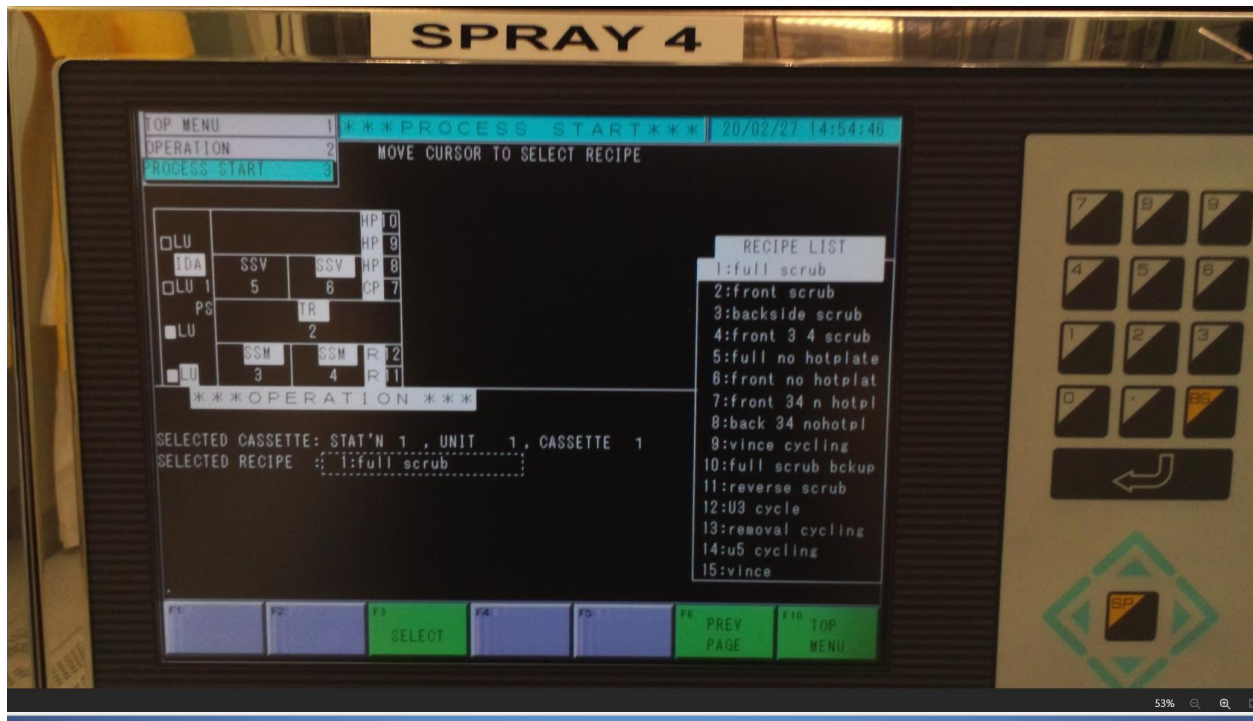
Vintage:

Missing parts: none

Defected parts: none

Software:

Operating system:



SPRAY1 – SPRAY2 – SPRAY3: Configuratie

Spray1&2	Product	Toepassing
Spinstation 3 en 4	Softspray	Cleanen van wafers voornamelijk achterkant
Spinstation 5 en 6	Nanospray	Cleanen van wafers alleen voorzijde want de wafer ligt op een chuck
Cold plate	Koude plaat	koeling
Hot plate	Hete plaat	<u>drogen</u>

Spray3	Product	Toepassing
Spinstation 3, 4, 5 en 6	Nanospray	Cleanen van wafers alleen voorzijde want de wafer ligt op een chuck

Spray4	Product	Toepassing
Spinstation 3 en 4	<u>Softspray</u>	Cleanen van wafers voornamelijk achterkant
Spinstation 5 en 6	<u>Softspray</u>	Cleanen van wafers alleen voorzijde want de wafer ligt op een chuck
Cold plate	Koude plaat	koeling
Hot plate	Hete plaat	<u>drogen</u>

